

## СИЛЫ ОСЦИЛЛЕТОРОВ ОПТИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ В МЕЛКИХ ПРИМЕСЯХ И ПРИМЕСНЫХ КОМПЛЕКСАХ В КРЕМНИИ И ГЕРМАНИИ

Андреев Б. А., Козлов Е. Б., Лифшиц Т. М.

Приведены результаты определений сил осцилляторов (СО) внутрипримесных оптических переходов из спектров примесного оптического поглощения для примесей Р, В и Al в кремнии и В и Al в германии. Кроме того, указана возможность определения СО оптических переходов в мелких примесных комплексах по зависимостям СО от энергии основного состояния примеси и нахождения по ним концентраций комплексов в высокочистых полупроводниках.

Развитие методов оптической и фототермоионизационной спектроскопии полупроводников применительно к исследованию примесных состояний и анализу химического состава примесей в высокочистых полупроводниковых материалах (см., например, [1]) стимулировало появление теоретических [2–8], а в последнее время и экспериментальных работ [9–11] по определению важнейших спектроскопических характеристик примесей — сил осцилляторов (СО) внутрипримесных оптических переходов  $f$ , в первую очередь в кремнии и германии. Пока еще экспериментальные работы по определению СО исчисляются единицами и расходжение полученных данных с результатами теоретических расчетов существенное. В единственной известной нам работе, где приведены данные об интенсивности оптических переходов в акцепторах в кремнии [11], экспериментально определялись относительные (по отношению к переходу  $1\Gamma_5^+ \Rightarrow 5\Gamma_8$ ) интенсивности линий примесного поглощения в Si : B, отвечающих переходам в более высокие возбужденные состояния. Форма линий считалась лорентцевой. Приведены также значения СО, которые получены умножением найденного отношения интенсивностей линий на теоретическое значение  $f$  для перехода  $1\Gamma_5^+ \Rightarrow 5\Gamma_8$  из работы [6], рассчитанное в приближении эффективной массы (ПЭМ) для энергии основного состояния примеси  $E_i$ , следующей из этого приближения. Эти результаты нельзя использовать в практической спектроскопии, так как теоретические, расчеты [7, 8], так же как и вид спектров примесного поглощения (см., например, [2]), указывают на то, что  $f$  существенно зависит от  $E_i$ , и такой расчет СО имеет смысл только для переходов в примесях определенной химической природы. В настоящей работе приведены результаты определений СО из спектров примесного оптического поглощения для примесей Р, В и Al в кремнии и В и Al в германии. Кроме того, указана возможность определения СО оптических переходов в мелких примесных комплексах по зависимостям  $f(E_i)$  и нахождения по ним концентраций комплексов в высокочистых полупроводниках.

Мы исследовали поглощение в монокристаллических образцах Si и Ge посредством измерения пропускания плоскопараллельных монокристаллических пластинок названных полупроводников толщиной 1–2 мм, содержащих Р, B,

Al в концентрации  $N < 10^{13} \text{ см}^{-3}$  в Ge и B, Al, P в концентрации  $N < 1 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$  в Si. Концентрации примесей определяли из низкотемпературных измерений коэффициента Холла. Для некоторых образцов германия, содержащих сравнимые концентрации B и Al, определение концентрации каждой из примесей проводилось с учетом отношений интенсивностей линий поглощения и получаемых значений CO. Для предотвращения перезарядки примесей при измерениях использовали холодные фильтры, исключавшие облучение образцов излучением из фундаментальной полосы поглощения полупроводника. Величины CO для переходов в разных примесях в Si и Ge измеряли на 3—4 образцах. Далее приведены средние значения этих величин. Разброс значений  $f$  для разных образцов не превышал  $\pm 10\%$  измеряемой величины. Измерения проводили на фурье-спектрометре «Вгикер» IFS-120HR. Образцы помещали перед чувствительным элементом стандартных болометров Лоу и вместе с чувствительным элементом болометров охлаждали до 4.2 K. Преобразование спектров пропускания в спектры поглощения, коррекцию базовой линии и определение площади  $S_1$  под контурами линий ( $\text{в см}^{-2}$ ) проводили с помощью программного обеспечения спектрометра, после чего, используя правило сумм [2, 3]

$$S = \int d\nu \sigma(\nu) = (\pi h e^2 / cm_0) (E_{\text{eff}} / E_0)^2 / Mx^{1/2} = \\ = 1.0976 \cdot 10^{-13} [\text{мэВ} \cdot \text{см}^2] / Mx^{1/2},$$

определяли силы осцилляторов отдельных переходов:

$$f = S_1 / S = S_1 / NS = \frac{c^2 m_0 M}{\pi e^2} [E_0 / E_{\text{eff}}]^2 \frac{x^{1/2} S_1}{N} = \\ = 1.13 \cdot 10^{12} [\text{см}^{-1}] \frac{x^{1/2} S_1 M}{N}.$$

В этих формулах  $S_1$  и  $S$  — площадь линии и площадь под всем спектром примесного поглощения соответственно, приходящимся на один примесный центр ( $S_1 = S/N$ );  $m_0$  — масса электрона,  $x$  — диэлектрическая проницаемость кристалла (в Si  $x = 11.48$  [13], в Ge  $x = 15.40$  [5]). Для мелких примесей отношение эффективного поля, индуцирующего переход, к среднему полю ( $E_{\text{eff}} / E_0 = 1$ ). Для доноров  $M$  есть средняя относительная эффективная масса:  $M = \langle m \rangle / m_0 = 3 / m_0 (1/m_1 + 2/m_2)$  (0.258 в Si и 0.119 в Ge по данным [14, стр. 38, 39]), для акцепторов  $M = 1/\gamma_1$  ( $\gamma_1$  — параметр Латтингера, равный 4.22 в Si и 13.35 в Ge [15]). С учетом приведенных значений параметров величины CO внутрипримесных оптических переходов в донорах и акцепторах в кремнии и германии равны

$$f(\text{Si, D}) = 0.987 \cdot 10^{12} [\text{см}^{-1}] S_1 / N, f(\text{Ge, D}) = 0.5275 \cdot 10^{12} [\text{см}^{-1}] S_1 / N, \\ f(\text{Si, A}) = 0.907 \cdot 10^{12} [\text{см}^{-1}] S_1 / N, f(\text{Ge, A}) = 0.332 \cdot 10^{12} [\text{см}^{-1}] S_1 / N$$

(здесь  $S_1$  [в  $\text{см}^{-2}$ ]).

В табл. 1 приведены определенные указанным путем силы осцилляторов  $f$  внутрипримесных оптических переходов в Si и Ge и теоретические значения  $f$  из работ [5, 7, 8]. Видно, что в отличие от экспериментальных данных, приведенных в [7, 9], измеренные нами величины  $f$  для переходов в акцепторах очень близки к теоретическим значениям. С другой стороны, наши данные для фосфора в кремнии, так же как и результаты [9], значительно (в 1.5—2 раза) расходятся с теоретическими расчетами [5, 7]. Причина этого остается невыясненной.<sup>1</sup>

В фототермоионизационных (ФТИ) спектрах чистых образцов кремния и германия часто выявляются линии примесных комплексов (Li, O), (H, C), (H, Si)

<sup>1</sup> В [7] указано, что точность расчета волновых функций основных состояний примесей в рамках ПЭМ может оказаться недостаточной для обеспечения хорошего соответствия вычисленных значений CO с измеренными.

Таблица 1

Частоты  $\nu$  и силы осцилляторов  $f$  внутрипримесных оптических переходов \*

Переход	$\nu, \text{см}^{-1}$	$f \cdot 10^3$		Переход	$\nu, \text{см}^{-1}$	$f \cdot 10^3$	
		эксперимент	теория			эксперимент	теория
Si : P							
$1s \Rightarrow 2P_0$	275.191	16.9	31.3	$1s \Rightarrow 4P_{\pm}$	349.953	5.7	10.8
$2P_{\pm}$	316.021	82.9	133	$5P_{\pm}$	352.308	1.0	3.7
$3P_0$	323.457	2.7	6.44	$6P_{\pm}$	355.814	3.0	9.09
$4P_0$	340.947	1.2	2.55	$8P_{\pm}$	358.834	1.5	4.30
$3P_{\pm}$	342.449	15.8	30.4				
Si : B							
$1\Gamma_8^+ \Rightarrow 1\Gamma_8^-$	245.064	17.5	17.7	$1\Gamma_8^+ \Rightarrow 5\Gamma_8^-$	334.59	1.3	1.7
$2\Gamma_8^-$	278.115	64.3	64.0	$2\Gamma_7^-$	339.87	2.5	3.1
$3\Gamma_8^-$	309.603	5.3	5.4	$3\Gamma_6^-$	344.68	6.8	7.8
$1\Gamma_7^-$	319.298			$4\Gamma_7^-$			
$1\Gamma_6^-$	319.793	62.3	63.6	$6\Gamma_7^-$	352.84	1.1	0.88
$4\Gamma_8^-$	321.865	2.3	2.3				
Si : Al							
$1\Gamma_8^+ \Rightarrow 1\Gamma_8^-$	442.871	6.7	6.7	$1\Gamma_8^+ \Rightarrow 4\Gamma_8^-$	525.908	2.6	2.2
$2\Gamma_8^-$	472.178	23.2	27.6	$2\Gamma_7^-$	538.803	1.6	1.2
$1\Gamma_7^-$	516.777	7.2	8.4	$3\Gamma_6^-$	543.725	1.9	1.9
$1\Gamma_6^-$	524.265	14.6	14.6				
Ge : B							
$1\Gamma_8^- \Rightarrow 2\Gamma_8^-$	64.071	101.6	100.7	$1\Gamma_8^+ \Rightarrow 1\Gamma_7^-$	70.119	61.2	64.3
				$3\Gamma_8^-$			
Ge : Al							
$1\Gamma_8^+ \Rightarrow 2\Gamma_8^-$	66.786	97.5	97.0	$1\Gamma_8^+ \Rightarrow 4\Gamma_8^-$	77.922	5.2	5.7
$1\Gamma_7^-$	72.859	64.5	62.3				
$3\Gamma_8^-$							

Примечание. \* Теоретические значения  $f$  для  $n$ -Ge и  $n$ -Si взяты из [5], для  $p$ -Ge — из [7], для  $p$ -Si — из [8].

и др. Энергии оптических переходов в этих комплексах и соответственно энергии ионизации определяются из названных спектров, но силы осцилляторов из спектров поглощения определить трудно из-за малой концентрации комплексов. В то же время, учитывая, что комплексы практически всегда присутствуют вместе с другими примесями, при известных СО и полной концентрации нескомпенсированных примесей (которая легко определяется) можно было бы определять концентрации комплексов из ФТИ спектров по соотношению площадей соответствующих линий, принадлежащих им и элементарным примесям.

Величины СО для мелких примесных комплексов с точностью, практически не уступающей точности теоретических (или экспериментальных) определений, можно получить, воспользовавшись зависимостями  $f$  от  $E_i$ . Такие зависимости можно построить (рис. 1—4) для каждого перехода по рассчитанным теоретически (или измеренным) данным для элементарных примесей, а затем из этих кривых по известным  $E_i$  комплексов определить СО для них интерполяцией. Основные состояния многих комплексов в Si и Ge расщеплены. Если величина расщепления  $\Delta \ll kT$  ( $k$  — постоянная Больцмана,  $T$  — температура), то можно принять за

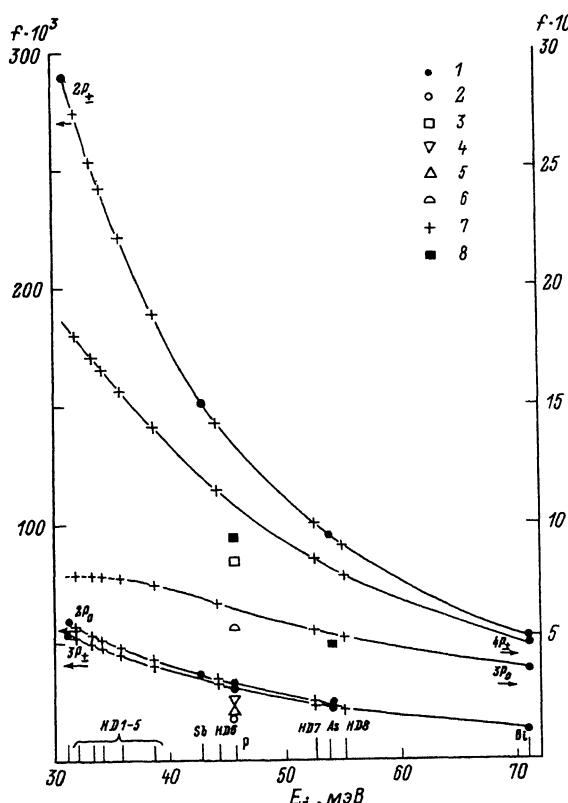


Рис. 1. Зависимости сил осцилляторов  $f$  оптических переходов из основного состояния в конечные, указанные у кривых, в донорах в кремнии от энергии ионизации примеси  $E_i$ .

Кривые построены по теоретическим значениям  $f$  (1) для элементарных примесей, взятым из [5]. Экспериментальные данные для кривых 2 –  $2P_0$ , 3 –  $2P_{\pm}$ , 4 –  $3P_0$ , 5 –  $3P_{\pm}$ ; 8 – экспериментальные данные из [1, 2]. Знаком 7 на кривых отмечены величины  $f$  для переходов в примесных комплексах, соответствующие их энергиям ионизации.

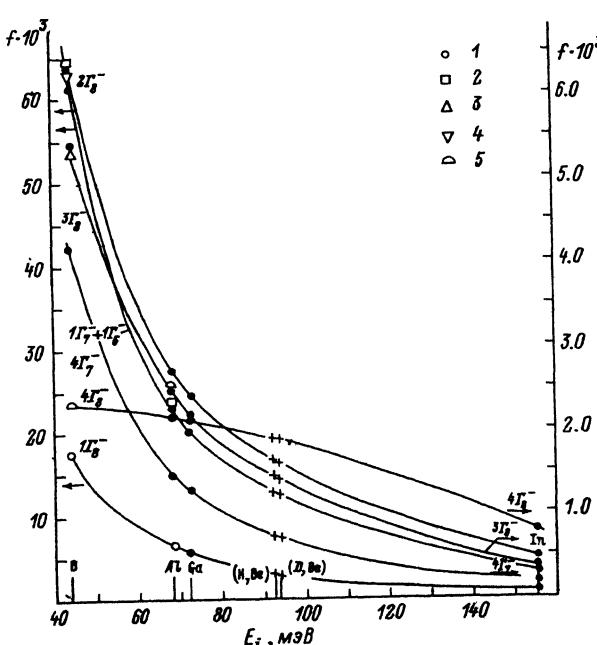


Рис. 2. Зависимости сил осцилляторов  $f$  оптических переходов в акцепторах в кремнии.

Кривые построены по данным теоретических расчетов для элементарных акцепторов в Si [5]. Экспериментальные данные для кривых 1 –  $1\Gamma_8^-$ , 2 –  $2\Gamma_8^-$ , 3 –  $3\Gamma_8^-$ , 4 –  $1\Gamma_7^- + 1\Gamma_6^-$ , 5 –  $4\Gamma_8^-$ .

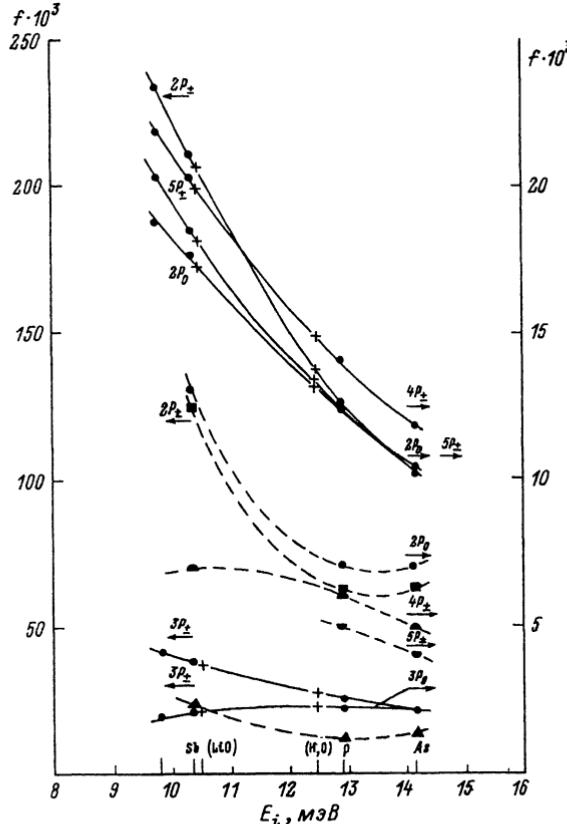


Рис. 3. Зависимости сил осцилляторов  $f$  оптических переходов в донорах в Ge.

Кривые построены по результатам теоретических расчетов [5, 7]. Экспериментальные данные [7, 9] соединены штриховыми линиями только для удобства их рассмотрения.

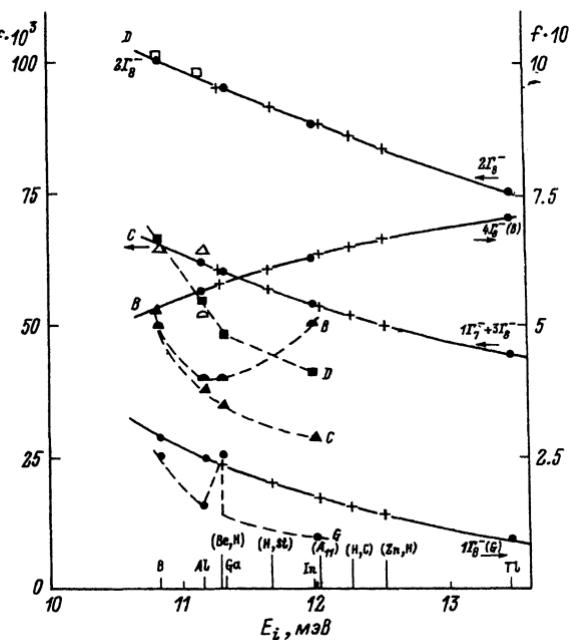


Рис. 4. Зависимости сил осцилляторов  $f$  оптических переходов в акцепторах в Ge.

Теоретические кривые взяты из [7].  
Эксперимент: светлые значки — наши данные,  
зачерненные значки — данные из [7]. Штриховые линии проведены только для удобства рассмотрения рисунка.

энергию ионизации ее среднее значение либо энергию нижнего состояния, если  $\Delta \gg kT$ . При этом найденные из кривых на рис. 1—4 СО комплексов следует считать суммарными величинами для всех компонент основного состояния. Доля каждого из них в отдельности легко определяется из отношения площадей соответствующих линий в ФТИ спектрах. На рис. 1—4 приведены зависимости  $f(E_i)$  для ряда переходов. На этих зависимостях отмечены энергии ионизации и СО для некоторых комплексов. Соответствующие значения СО комплексов приведены в табл. 2.

Таблица 2

Силы осцилляторов мелких примесных комплексов в Ge и Si

Комплекс	$E_i$ , мэВ	$f \cdot 10^3$				
		$1s \Rightarrow 2P_0$	$1s \Rightarrow 2P_{\pm}$	$1s \Rightarrow 3P_0$	$1s \Rightarrow 3P_{\pm}$	$1s \Rightarrow 4P_{\pm}$
Кремний						
<i>HD1</i>	31.8 [17]	56	273	7.8	52	17.9
<i>HD2</i>	33.3	53	253	7.8	49	17.1
<i>HD3</i>	34.1	51	242	7.7	47	16.5
<i>HD4</i>	35.8	47	221	7.6	45	15.7
<i>HD5</i>	38.6	42	189	7.4	40	14.1
<i>HD6</i>	44.2	33	142	6.7	32	11.4
<i>HD7</i>	52.5	24	110	5.4	23	8.5
<i>HD8</i>	55.3	21	91	5.1	21	7.8
Германий						
(Li, O)	10.46 [16]	17.2	202	2.17	36.4	19.8
(H, O)	12.46	13	136	2.2	26	14.8

Акцепторы

Комплекс	$E_i$ , мэВ	$f \cdot 10^3$			
		$1\Gamma_8^+ \Rightarrow 1\Gamma_8^-$	$1\Gamma_8^+ \Rightarrow 2\Gamma_8^-$	$1\Gamma_8^+ \Rightarrow 1\Gamma_7^- + 3\Gamma_8^-$	$1\Gamma_8^+ \Rightarrow 4\Gamma_8^-$
Кремний					
(H, Be)	92.56 [18]	3	16.7	12.7*	1.95
(D, Be)	93.53	2.5	16.3	12.3*	1.9
Германий					
(Be, H)	11.29 [19]	2.4	95.5	61	5.8
(H, Si)	11.66	2.0	92	57	6.1
(Al)	12.03	1.8	88	53.5	6.4
(H, C)	12.28	1.6	86	52	6.5
(Zn, H)	12.54	1.4	83.5	50	6.7

Примечание. \* Переход  $1\Gamma_8^+ \Rightarrow 1\Gamma_7^- + 3\Gamma_8^-$ .

Представленные в табл. 1, 2 и на рис. 1—4 значения СО позволяют определять концентрацию комплексов по спектрам ФТИ. В качестве примера рассмотрим задачу определения концентрации донорного комплекса (Li, O) в образце  $n$ -Ge с  $N_d = N_a = 4.9 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-3}$  и  $k = N_a/N_d = 0.25$  по спектру ФТИ, приведенному на рис. 5. Спектр содержит ФТИ переходы из основного состояния фосфора [ $E_i(P) = 12.88 \text{ мэВ}$ ], комплекса (Li, O), основное состояние которого расщеплено:  $E_i(\text{Li}, \text{O})_1 = 10.46$ ,  $E_i(\text{Li}, \text{O})_{2,3} \approx 10$  и  $E_i(\text{Li}, \text{O})_4 \approx 9.4 \text{ мэВ}$  [при данной температуре состояние ( $\text{Li}, \text{O})_4$  не заселено] и Li [ $E_i(\text{Li}) \approx 10 \text{ мэВ}$ ] [16]. Концентрацию каждой примеси  $N_i$  определяли по соотношению площадей  $S_i$  под спектральными линиями, соответствующими наиболее интенсивному переходу из основного состояния примеси на уровень  $2P_{\pm}$ :

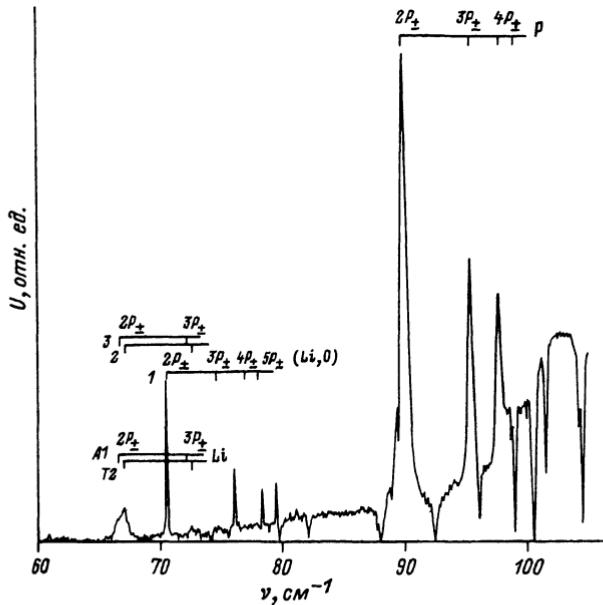


Рис. 5. Спектр фотопроводимости образца *n*-германия,  $N_d - N_a = 4.9 \cdot 10^{11}$  ат/см<sup>3</sup>. Разрешение спектрометра  $0.1 \text{ см}^{-1}$ ,  $T = 5.2 \text{ К}$ . Обозначение переходов взято из [16].

$$\frac{N_1}{N_2} = f_2 S_1 / f_1 S_2.$$

Так как частоты перехода  $1s \Rightarrow 2P_{\pm}$  в Li и в комплексе  $(\text{Li}, \text{O})_{2,3}$  близки, площадь линии для перехода  $1s \Rightarrow 2P_{\pm}$  в Li на частоте  $67 \text{ см}^{-1}$  определяли, вычитая площадь, приходящуюся на мультиплет основного состояния комплекса  $(\text{Li}, \text{O})_{2,3}$  с учетом его заселенности. С привлечением данных по CO концентрация каждой нескомпенсированной примеси оказалась равной:  $N_{\text{Li}} = 1.5 \cdot 10^{10}$ ,  $N_{\text{Li}, \text{O}} = 3.5 \cdot 10^{10}$ ,  $N_p = 4.4 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-3}$ .

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Андреев Б. А., Лифшиц Т. М. // Высокочистые вещества. 1990. № 5. С. 7—22.
- [2] Коган Ш. М., Полупанов А. Ф. // ФТП. 1978. Т. 12. В. 9. С. 1844—1848.
- [3] Коган Ш. М., Полупанов А. Ф. // ЖЭТФ. 1981. Т. 80. С. 394—411.
- [4] Коган Ш. М., Таскинбоев Р. // ФТП. 1983. Т. 17. В. 9. С. 1583—1587.
- [5] Бейникес И. Л., Коган Ш. М. // ЖЭТФ. 1987. Т. 93. С. 285—301.
- [6] Bingelli N., Baldereschi A. // Sol. St. Commun. 1988. V. 66. P. 323—328.
- [7] Clauws P., Broeckx J., Rotsaert E., Vennik J. // Phys. Rev. B. 1988. V. 38. N 17. P. 12377—12382.
- [8] Beinikhes I. L., Kogan Sh. M., Novak M. G., Polupanov A. F. // Materials Science Forum. Proc. IV Int. Conf. on Shallow Impurities in Semicond. London, 1990. V. 65—66. P. 259—264.
- [9] Rotsaert E., Clauws P., Vennik J., van Goethem L. // J. Appl. Phys. 1989. V. 65. P. 730—735; Physica B. 1987. V. 146B. P. 75—79.
- [10] Андреев Б. А., Иконников В. Б., Козлов Е. Б., Лифшиц Т. М., Шмагин В. Б. // Письма ЖЭТФ. 1989. Т. 49. С. 39—42.
- [11] Lewis R. A., Fisher P., McLean N. A. // Proc. III Int. Conf. on Shallow Impurities in Semicond. Linköping, 1988. Inst. Phys. Conf. Ser. N 95. Chapter 2. P. 95—100.
- [12] Burstein T., Picus G., Henvis B., Wallis R. // J. Phys. Chem. 1956. V. 1. P. 65—74.
- [13] Loewenstein T. V., Smith D. R., Morgan R. L. // Appl. Optics. 1973. V. 12. P. 398—406.
- [14] Гавриленко В. И., Грехов А. М., Корбутяк Д. В., Литовченко В. Г. Оптические свойства полупроводников. Справочник. Киев, 1987. С. 608.
- [15] Baldereschi A., Lipari N. O. // Phys. Rev. B. 1973. V. 8. P. 2697—2709; Phys. Rev. B. 1974. V. 9. P. 1525—1539.

- [16] Darken L. S. // Phys. Rev. B. 1983. V. 27. N 10. P. 6564—6567; J. Appl. Phys. 1989. V. 65. N 3. P. 1118—1125.
- [17] Hartung J., Weber J., Genzel L. // Material Science Forum. 1990. V. 65-66. P. 157—162.
- [18] Muro K., Sievers J. // Phys. Rev. Lett. 1986. V. 57. P. 897.
- [19] Kahn J. M., McMurray R. E., Haller E. E., Falicov L. M. // Phys. Rev. B. 1987. V. 36. P. 8001—8014.

Институт химии высокочистых веществ РАН  
Нижний Новгород  
Институт радиотехники и электроники РАН  
Москва

Получена 19.12.1991  
Принята к печати 28.12.1991

---